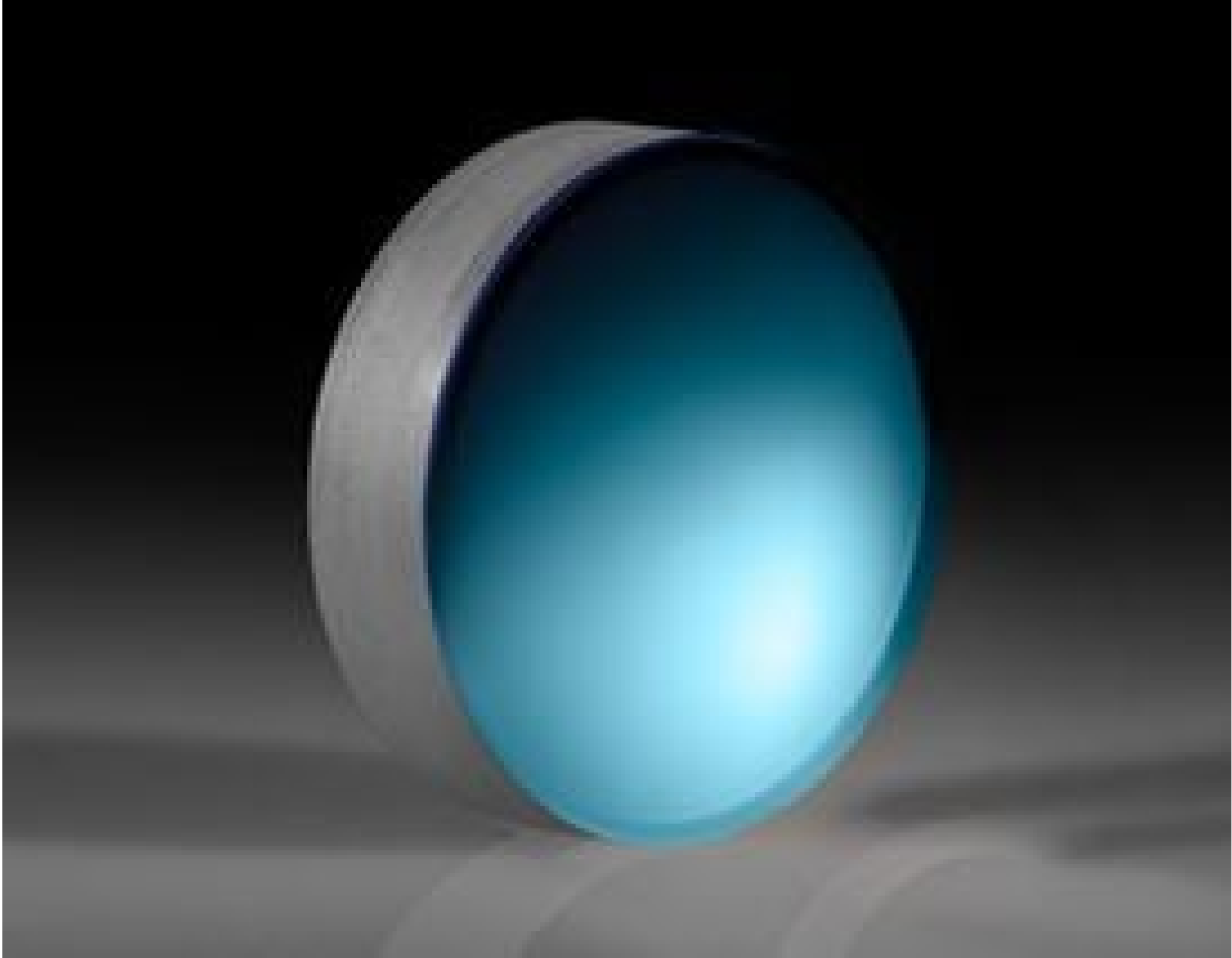


TECHSPEC®

Miroir Laser Ultrarapide en Silicium Traité Argent Amélioré, 800 - 1150 nm, 12,7 mm de Dia.



Stock #90-194 NOUVEAU 4 In Stock

-

1

+

€88<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €88,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

|             |       |
|-------------|-------|
| Flat Mirror | Type: |
|-------------|-------|

Propriétés physiques et mécaniques

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <3               | Parallélisme (arcmin): |
| 90               | Ouverture Utile (%):   |
| Surface Arrière: |                        |

|                                                                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Commercial Polish                                                                                                              |                                |
| 12.70 +0.00/-0.10                                                                                                              | Diamètre (mm):                 |
| 3.18 ±0.10                                                                                                                     | Épaisseur (mm):                |
| Ground, protective bevel as needed                                                                                             | Bords:                         |
| Propriétés optiques                                                                                                            |                                |
| 40-20                                                                                                                          | Qualité de Surface:            |
| Ravg >99% @ 850 - 1150nm, 0° Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45° Rp >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°                                        | Spécification du Traitement:   |
| 0 ±30 fs <sup>2</sup> @ 800-1100 nm                                                                                            | GDD Specification:             |
| 800 - 1150                                                                                                                     | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| λ/10                                                                                                                           | Planéité de Surface (P-V):     |
| Ultrafast-Enhanced Silver                                                                                                      | Type de Traitement:            |
| Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)                                                                                         | Traitement:                    |
| Optical Grade Silicon                                                                                                          | Substrat: □                    |
| 0.35 J/cm <sup>2</sup> @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical) 0.10 J/cm <sup>2</sup> @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical) | Damage Threshold, Reference: □ |
| Conformité réglementaire                                                                                                       |                                |
| Visionner                                                                                                                      | Certificate of Conformance:    |

## Description produit

- Substrat de silicium pour les systèmes de lasers à impulsions ultracourtes exigeants sur le plan thermique
- Idéaux pour les système basés sur les lasers à impulsions ultracourtes Ti:saphir et Yb
- Conçus pour la réflexion d'impulsions ultrarapides où une faible dispersion est essentielle
- GDD <30 fs<sup>2</sup> dans les gammes de longueurs d'onde cibles

Les Miroirs Laser Ultrarapides en Silicium Traités Argent Amélioré TECHSPEC® combinent un traitement argenté amélioré à large bande avec une faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour les applications d'impulsions ultra-rapides. Ces miroirs sont conçus pour les systèmes où le maintien de la fidélité de l'impulsion est essentiel, et la réflectivité et la GDD sont caractérisées dans la gamme de longueurs d'onde spécifiée de 600 - 1000 nm ou 800 - 1150 nm, respectivement. Ces miroirs à substrat de silicium présentent une conductivité thermique plus élevée que les [miroirs à substrat en silice fondue](#) comparables, ce qui permet de répartir uniformément la chaleur absorbée dans les configurations optiques exigeantes sur le plan thermique. Les Miroirs Laser Ultrarapides en Silicium Traités Argent Amélioré TECHSPEC® sont idéaux pour la propagation de faisceaux ultrarapides à large bande où une réflectivité élevée, une dispersion contrôlée et un substrat thermiquement robuste sont souhaités.